

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】令和4年5月24日(2022.5.24)

【国際公開番号】WO2021/240962

【出願番号】特願2021-574330(P2021-574330)

【国際特許分類】

C 2 3 C 14/08(2006.01)

C 2 3 C 14/34(2006.01)

H 0 1 B 13/00(2006.01)

B 3 2 B 7/025(2019.01)

10

【F I】

C 2 3 C 14/08 D

C 2 3 C 14/34 R

H 0 1 B 13/00 5 0 3 B

B 3 2 B 7/025

【手続補正書】

【提出日】令和3年12月28日(2021.12.28)

【手続補正1】

20

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数のターゲットのそれぞれに電力を印加する複数回のスパッタリングによって、光透過性導電性層を、基材シートの厚み方向一方向に形成する工程を備え、

前記光透過性導電性層を形成する工程は、

前記複数のターゲットに含まれる第1ターゲットであって、酸化インジウムと酸化スズとを含み、前記酸化スズの含有率が8質量%を超えるインジウム-スズ複合酸化物からなる前記第1ターゲットに電力を印加して、内側層を前記基材シートの前記厚み方向一方向に形成する第1工程と、

30

前記第1ターゲット以外のターゲットに電力を印加して、外側層を前記内側層の厚み方向一方向に形成する第2工程とを備え、

前記複数のターゲットにおける合計の電力密度Pに対する、前記第1ターゲットにおける電力密度P1の比(P1/P)が、0.10以下であることを特徴とする、光透過性導電性シートの製造方法。

【請求項2】

前記第1工程では、反応性ガスを含むスパッタリングガスの雰囲気下、スパッタリングし

40

、前記第2工程では、反応性ガスを含むスパッタリングガスの雰囲気下、スパッタリングし

、前記第2工程における前記スパッタリングガスにおける反応性ガスの割合R2に対する、前記第1工程における前記スパッタリングガスにおける反応性ガスの比R1の比(R1/R2)が、1以下であることを特徴とする、請求項1に記載の光透過性導電性シートの製造方法。

【請求項3】

前記第2工程の後に、前記光透過性導電層を結晶化する第3工程をさらに備えることを特徴とする、請求項1または2に記載の光透過性導電性シートの製造方法。

50